

Vorwort

Der vorliegende Band ist das erste Sonderheft der Zeitschrift. Für die Zukunft ist die Herausgabe anlassbezogener Schwerpunktheft in lockerer Reihenfolge geplant. Der hier präsentierte Beitrag zu den Grundlagen des japanischen Patent- und Gebrauchsmusterrechts aus der Feder führender deutscher Experten ist Teil des für das Frühjahr 2010 in Vorbereitung befindlichen umfassenden Werkes „Handbuch Japanisches Handels- und Wirtschaftsrecht“, das von den Unterzeichnern im Carl Heymanns Verlag herausgegeben wird. Die Autoren des Beitrages sind am Ende des Heftes vorgestellt.

Konkreter Anlass für die Publikation dieses Bandes ist das von der *Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung* im September 2009 in München mit Hilfe und Förderung der Patent- und Rechtsanwaltssozietät *HOFFMANN · EITLÉ* München/London, und in Zusammenarbeit mit der *JIPA*, der *JPAA* und der *AIPPI Japan* ausgerichtete Symposium zu dem Thema „Der Patentverletzungsprozess in Japan und Deutschland“. Die Beiträge zu der hochkarätig besetzten Tagung werden im Frühjahr 2010 als zweiter Band in dieser Reihe erscheinen. Der jetzt vorgelegte erste Band soll einerseits diese Veröffentlichung vorbereiten, indem der allgemeine rechtliche Hintergrund ausgeleuchtet wird, andererseits und vor allem aber soll er in kompakter Form das für die Praxis eminent wichtige Patent- und Gebrauchsmusterrecht Japans erschließen.

Hamburg / Frankfurt am Main im November 2009

Harald Baum

Moritz Bälz